# Релаксация электронных возбуждений в оксиде бериллия: время-разрешенная ВУФ-спектроскопия

© В.А. Пустоваров, В.Ю. Иванов, М. Кирм\*, А.В. Кружалов, А.В. Коротаев, Г. Циммерер\*

Уральский государственный технический университет, 620002 Екатеринбург, Россия \* II Институт экспериментальной физики Гамбургского университета, D22761 Гамбург, Германия

E-mail: ivy@dpt.ustu.ru

#### (Поступила в Редакцию 13 ноября 2000 г.)

С использованием техники время-разрешенной оптической и люминесцентной вакуумной ультрафиолетовой спектроскопии изучены низкотемпературные спектры и кинетика затухания люминесценции (2.5-10 eV, 1-500 ns) при селективном фотовозбуждении, а также спектры возбуждения люминесценции и отражения (8-35 eV) кристаллов BeO с ориентацией оптической оси параллельно и перпендикулярно электрическому вектору возбуждающего поляризованного синхротронного излучения. Установлено многообразие каналов излучательной релаксации электронных возбуждений, выявлена различная мультиплетность возбужденных состояний автолокализованных экситонов в зависимости от энергии возбуждения и ориентации образцов.

Настоящее исследование поддержано грантами Российского фонда фундаментальных исследований (№ 02-16206), Министерства образования РФ (№ 992886) и Немецкого исследовательского общества (Deutsche Forschungsgemeinschaft — DFG, грант ZI-159/4-1).

Проявления автолокализованных экситонов (АЛЭ) в широкозонных оксидных системах были обнаружены два десятилетия назад, однако пути образования возбужденных состояний и модели АЛЭ продолжают оставаться предметом дискуссии. В настоящее время установлено, что автолокализация экситонов характерна для оксидных соединений с низкой локальной симметрией кислородных узлов (SiO<sub>2</sub>, *α*-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, YAlO<sub>3</sub>, Y<sub>3</sub>Al<sub>5</sub>O<sub>12</sub> и др.) [1]. Как правило, экситонная структура на краю фундаментального поглощения в таких соединениях выражена крайне слабо или отсутствует совсем. Напротив, в высокосимметричных оксидных матрицах (MgO, CaO) с развитой структурой анионных экситонов в спектрах оптических констант автолокализация экситонов не реализуется. Следствием этого для оксидных систем является крайне низкая информативность спектров возбуждения люминесценции (СВЛ) в области края фундаментального поглощения для анализа путей образования возбужденных состояний АЛЭ. Эффективность такого анализа для щелочно-галоидных кристаллов (ШГК) продемонстрирована в [2,3]. Совместное исследование времяразрешенных спектров люминесценции и возбуждения люминесценции позволило выделить и систематизировать для ЩГК признаки трех типов АЛЭ, отличающихся степенью смещения двухгалоидного дырочного ядра от регулярного к интерстициальному положению, а также установить для каждого типа мультиплетность возбужденных состояний АЛЭ [2-4].

Кристаллы оксида бериллия имеют гексагональную структуру типа вюрцита и самую широкую среди оксидов зону запрещенных состояний ( $E_g = 10.63 \text{ eV}$ ). С позиций локальной симметрии кислородных узлов они занимают промежуточное положение между высоко-(MgO) и низкосимметричными (Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) матрицами. Существование в ВеO выделенного оптического направле-

ния делает возможным (в отличие от ЩГК) использование методов ориентационной спектроскопии. Развитая краевая экситонная структура была впервые обнаружена Ресслером [5] в спектрах отражения ВеО и в дальнейшем подробно исследовалась с привлечением техники синхротронного излучения (СИ) с ориентированных образцов [6-8]. В то же время широкие полосы 4.9 и 6.7 eV в спектре люминесценции (СЛ) ВеО интерпретированы как излучательный распад двух типов АЛЭ [9], отличающихся конфигурацией дырочного ядра — полярона малого радиуса типа О<sup>-</sup>-иона в локальном фрагменте кристаллической решетки. В ЩГК люминесценция триплетных АЛЭ может возникать как по чисто экситонному механизму в результате автолокализации экситонов, так и в результате рекомбинации электронов с автолокализованными дырками [1,4]. В то же время для некоторых кристаллов комплексных оксидов, оксидов металлов III группы [10-12] в последние годы установлено ветвление излучательной релаксации электронных возбуждений (ЭВ) по различным каналам. Ряд экспериментальных работ по ВеО [9,11,13,14] также содержит косвенные указания на проявление многообразия каналов релаксации и различную мультиплетность возбужденных состояний АЛЭ в ВеО.

Настоящая работа является продолжением цикла работ [9,15] по изучению релаксации ЭВ в ВеО. Рассмотрены пути создания возбужденных состояний АЛЭ посредством экспериментального изучения время-разрешенных спектров и кинетики затухания люминесценции в УФ-и ВУФ-областях при селективном фотовозбуждении, а также время-разрешенных СВЛ ориентированных кристаллов оксида бериллия. Представлены результаты, полученные при T = 10 К, так как только при низкой температуре в ВеО реализуются все виды излучательной релаксации ЭВ.

#### Образцы, техника и методика эксперимента

Кристаллы были выращены по методике [16] из раствора в расплаве вольфрамата натрия В.А. Масловым. Содержание примесей в образцах контролировалось методом лазерной масс-спектрографии и не превышало следующих уровней (ppm): Na — 140, Li — 10, Mg — 70, Zn — 7, В — 16, Аl — 2. Образцы представляли собой монокристаллы с естественными ростовыми или полированными гранями (призмы или пластинки), ориентированными параллельно или перпендикулярно оптической оси С кристалла. При исследовании кристаллов с выделенной оптической осью существуют две ориентации, альтернативные Е || С. Одна из них реализуется, когда ось системы регистрации люминесценции совпадает по направлению с оптической осью С кристалла. При дальнейшем анализе будем называть такую ориентацию Е  $\perp$  С<sub>0</sub>. В другом случае оптическая ось кристалла и ось наблюдения перпендикулярны, и эту взаимную ориентацию в дальнейшем будем обозначать  $E \perp C$ .

Измерения были выполнены на станции SUPERLUMI (лаборатория HASYLAB, DESY, Гамбург) [17]. Для возбуждения люминесценции в области 6-35 eV использовался 2 т вакуумный монохроматор со сменными решетками. СВЛ были нормированы на равное число падающих на кристалл фотонов с применением салицилата натрия. СЛ в области 2.5-6.0 eV анализировались с помощью монохроматора В&М (схема Czerny-Turner) и фотоэлектронного умножителя (ФЭУ) R2059 (Hamamatsu), в области 4-10 eV — с помощью второго 0.5 m вакуумного монохроматора и солнечно-слепого ФЭУ R6836. СЛ и СВЛ были измерены как для времяинтегрированной люминесценции, так и для люминесценции, детектируемой во временных окнах (ширина временно́го окна  $\Delta_t$ ), коррелированных относительно возбуждающего импульса СИ (задержка от начала импульса СИ  $\delta_t$ ).  $\Delta_t$  и  $\delta_t$  исходя из кинетики затухания были установлены 2.2 и 8.2 ns для быстрого компонента и 23 и 111 ns для медленного компонента соответственно. СЛ быстрых компонентов кинетики затухания люминесценции, показанные на рисунках, получены путем вычитания СЛ медленного компонента (с соответствующим коэффициентом) из экспериментально измеренного СЛ в "быстром" временном окне. Параметры кинетики затухания определялись методом расчета интеграла свертки. Спектры отражения (СО) измерялись при угле падения СИ 17.5° одновременно с СВЛ, при этом для исключения вклада люминесценции в формирование СО они получались так же, как и СВЛ, в отдельном "быстром" временном окне ( $\Delta_t = 22.5 \,\mathrm{ns}, \, \delta_t = 2.0 \,\mathrm{ns}$ ) с регистрацией сигнала от салицилата натрия. Измерения проводились при  $T = 10 \,\mathrm{K}$  в криостате, обеспечивающем вакуум не хуже  $2 \cdot 10^{-10}$  Torr, что гарантировало чистоту поверхности кристаллов в низкотемпературных экспериментах. Контрольные измерения ориентационных зависимостей были выполнены на одной и той же естественной грани роста образца, имевшего форму призмы.

## 2. Спектры излучения и селективного возбуждения люминесценции

Время-разрешенные СЛ и спектры селективного фотовозбуждения люминесценции в ВеО обнаруживают выраженную ориентационную зависимость. В случае когда вектор Е возбуждающего СИ совпадает по направлению с оптической осью С кристалла (Е || С), начальная стадия затухания ультрафиолетовой люминесценции в зависимости от энергии возбуждающего излучения представлена по крайней мере двумя составляющими (максимумы полос 4.0 и 5.0 eV, ширина на полувысоте (FWHM)  $\sim 1.0 \,\text{eV}$ ) (рис. 1). При постепенном увеличении энергии возбуждающего СИ в области края фундаментального поглощения и начала межзонных переходов спектр начальной стадии затухания люминесценции смещается в длинноволновую сторону. При этом в СВЛ быстрых компонентов свечения можно отметить, что полоса 4.0 eV наиболее эффективно возбуждается в области, соответствующей максимумам  $E_{n=2}$ , *Е*<sub>*n*=3</sub> экситонного отражения, в то время как свечение 5.0 eV — в области энергий 10.2-10.3 eV, расположенной значительно ниже первого максимума экситонного отражения  $E_{n=1}$  (рис. 2, *a*). Для сравнения заметим, что непосредственно примыкает к энергии Е<sub>n=1</sub> полоса 10.38 eV в СВЛ медленного компонента для свечения 4.7 eV (рис. 2, b).



**Рис. 1.** Время-разрешенные спектры фотолюминесценции BeO (T = 10 K) при ориентации кристалла **E** || **C** и энергиях возбуждения 10.25 (*a*) и 10.7 eV (*b*). *1* — спектр в "быстром" временном окне, *2* — спектр в "медленном" временном окне, *3* — разностный спектр и его аппроксимация гауссианом.



**Рис. 2.** Спектры возбуждения ультрафиолетовой люминесценции 3.35 (1) и 4.75 eV (2) BeO (T = 10 K) в "быстром" (a) и "медленном" (b) временны́х окнах при ориентации кристалла E || C в сравнении со спектром отражения (3).

Быстрое свечение 4.0 eV при возбуждении фотонами в области  $E_{n=2}$  характеризуется временем затухания 2.2 ns, а быстрое свечение 5.0 eV при возбуждении в области  $E_{n=1}$  — временем затухания 4.4 ns (рис. 3). Следует отметить, что этот результат подтверждает данные работ [13,14], в которых впервые был зарегистрирован спектр, определены параметры кинетики затухания ( $\tau = 2.0\,\mathrm{ns}$ ) и степень линейной поляризации (Р = +70%) быстрого УФ свечения в ВеО при возбуждении СИ рентгеновского диапазона. Степень линейной поляризации в [13,14] определялась как  $P = (I_{\parallel} - I_{\perp})/(I_{\parallel} + I_{\perp})$ , где  $I_{\parallel}$  — интенсивность свечения, измеренная при совпадении направления оси анализатора (призмы Рошона) и оптической оси С кристалла,  $I_{\perp}$  интенсивность свечения, измеренная при скрещенных осях. Однако в [13,14] быстрое свечение в области 5.0 eV при таком виде возбуждения обнаружено не было, как сейчас понятно из СВЛ, ввиду узкой области его эффективного избирательного возбуждения.

Медленная стадия затухания УФ-свечения при Е || С также представлена двумя компонентами в СЛ — полосами с максимумом 4.2 и 4.7 eV (в зависимости от энергии возбуждения) (рис. 1). При селективном возбуждении фотонами с  $E_{\text{exc}} = 9.5 \text{ eV}$  характерное время затухания свечения 4.2 eV составляет 34 пs. Люминесценция 4.2 eV очевидно связана с релаксацией ЭВ, локализованных около примесных или собственных дефектов кристалла, так как область 9.5-10.2 eV доминирует в его СВЛ (рис. 2, *b*), а сам СВЛ является довольно типич-



**Рис. 3.** Кинетика затухания люминесценции BeO при T = 10 K.  $a - E_{emiss} = 5.0$  eV,  $E_{exc} = 10.24$  eV,  $E \parallel C(1)$ ,  $E \perp C(2)$  и  $E \perp C_0(3)$ ;  $b - E_{emiss} = 3.35$  eV,  $E_{exc} = 10.67$  eV,  $E \parallel C(1)$ ,  $E \perp C(2)$  и  $E \perp C_0(3)$ ;  $c - E \parallel C$ ,  $E_{emiss} = 5.0$  eV,  $E_{exc} = 10.24(1)$ , 10.67 (2) и 11.27 eV (3);  $d - E \parallel C$ ,  $E_{emiss} = 3.35$  eV,  $E_{exc} = 10.24(1)$ , 10.67 eV (2), аппаратная функция импульса возбуждения (3). Виден систематический аппаратный выброс, учитывавшийся при анализе параметров кинетики и выборе временны́х окон Δ<sub>t</sub>.



**Рис. 4.** Время-разрешенные спектры фотолюминесценции BeO (T = 10 K) при ориентации кристалла  $\mathbf{E} \perp \mathbf{C}$  и энергиях возбуждения 10.2 (*a*) и 10.6 eV (*b*). *1* — спектр в "быстром" временном окне, *2* — спектр в "медленном" временном окне, *3* — разностный спектр и его аппроксимация гауссианом.

ным для примесного свечения BeO (см., например, CBЛ для BeO–Zn [15]). CBЛ медленного компонента 4.7 eV (его кинетику можно описать двухкомпонентной экспоненциальной зависимостью с  $\tau_1 = 54$  ns и  $\tau_2 = 36 \,\mu$ s, причем в последнем выделяется до 95% общей светосуммы) весьма похож по характеру на CBЛ быстрого компонента 5.0 eV: свечение 4.7 eV наиболее эффективно возбуждается в области энергий 10.38 eV, непосредственно примыкающей к  $E_{n=1}$  (рис. 2). Степень линейной поляризации медленного компонента при возбуждении рентгеновским СИ отрицательна и составляет при T = 80 K P = -50% [13,14].

Для ориентации кристалла  $\mathbf{E} \perp \mathbf{C}$  быстрый компонент УФ-свечения (полоса 4.0 eV) при одинаковых энергиях возбуждения выражен существенно меньше. Это хорошо видно из рис. 3, на котором представлена кинетика затухания люминесценции ВеО в зависимости от характерной энергии возбуждения и ориентации кристалла для областей спектра 4.0 и 5.0 eV, характеризующихся быстрыми компонентами свечения. Ориентационная зависимость кинетики затухания независимо подтверждается СВЛ, представленными на рис. 4, a, b, а также данными работ [13,14] по ориентационной зависимости быстрого УФ-свечения в ВеО при возбуждении рентгеновским СИ. Быстрое свечение 5.0 eV в этой ориентации не наблюдается при возбуждении в области экситонного поглощения и начала межзонных переходов, и СЛ, измеренный в "быстром" окне, практически не изменяется (максимум  $3.9 \,\text{eV}$ , FWHM =  $1.0 \,\text{eV}$ ) (рис. 4, b). Наибольшая эффективность возбуждения быстрого свечения, как и для ориентации **E** || **C**, приходится на область  $E_{n=2}$ ,  $E_{n=3}$  возбужденных состояний экситона (рис. 5, *a*). Спектральный состав медленного компонента при этой ориентации сосредоточен в полосе 4.5 eV ( $\tau = 52$  ns) (рис. 4, *b*), и его СВЛ отличается от СВЛ быстрого компонента 3.9 eV более высокой эффективностью возбуждения в области 10.4 eV, непосредственно примыкающей к энергии  $E_{n=1}$ (кривая 2 на рис. 5, *b*).

В ВУФ-области СЛ ВеО при T < 160 К характеризуется полосой 6.7 eV (FWHM ~ 0.8 eV) [9]. В кинетике затухания ВУФ-свечения ВеО (6.7 eV) при фотовозбуждении не обнаружено быстрых компонентов, и, как отмечено в предшествующих работах (например, [9]), она в основном представлена экспоненциальным компонентом с  $\tau = 340 \,\mu$ s. При ориентации кристалла **Е** || **С** ВУФ-свечение 6.7 eV (степень поляризации P = -75% по данным рентгенолюминесценции при



**Рис. 5.** Спектры возбуждения ультрафиолетовой люминесценции 3.35 (1) и 5.05 eV (2) BeO (T = 10 K) в "быстром" (a) и "медленном" временны́х окнах при ориентации кристалла  $\mathbf{E} \perp \mathbf{C}$  в сравнении со спектром отражения (3).



**Рис. 6.** Спектры возбуждения ВУФ-люминесценции 6.7 eV BeO (1, 2) в сравнении со спектрами отражения (3, 4) для ориентаций кристалла  $\mathbf{E} \parallel \mathbf{C} (1, 3)$  и  $\mathbf{E} \perp \mathbf{C} (2, 4)$ , T = 9.6 K.



**Рис. 7.** Спектры возбуждения люминесценции кристаллов ВеО при T = 10 K для  $E_{\text{emiss}} = 4.8 (I)$  и 6.7 eV (2) для различных ориентаций кристалла.

T = 80 K [9]) возбуждается в области основного  $E_{n=1}$  и, более эффективно, в области возбужденных  $E_{n=2}$ ,  $E_{n=3}$ состояний экситона, а также в области создания раздельных электронно-дырочных пар (кривая *1* на рис. 6). При этом эффективность возбуждения люминесценции в области межзонного поглощения ( $E_{\text{exc}} > E_g$ ) выше, чем в экситонной области. При ориентации  $\mathbf{E} \perp \mathbf{C}$  СВЛ 6.7 eV резко изменяется: свечение наиболее эффективно возбуждается в области  $E_{n=1}$  и значительно меньше в областях возбужденных состояний экситона и межзонных переходов при  $E_{\text{exc}} > E_g$  (кривая 2 на рис. 6).

На рис. 7 представлены стационарные (без временно́го разрешения) СВЛ 4.8 и 6.7 eV кристаллов ВеО в области  $E_{\rm exc} = 8-35$  eV. Обращает на себя внимание значительное различие эффективностей возбуждения этих свечений как в экситонной области, так и в области порога эффекта размножения ЭВ при  $E_{\rm exc} > 20$  eV. Пороговая энергия эффекта размножения ЭВ ( $E_{pm}$ ) для свечения 6.7 eV приходится на область создания вторичных экситонов  $E_{pm} \approx 2E_{n=1}$ , в то время как для свечения 4.8 eV на область генерации вторичных электронно-дырочных пар при  $E_{pm} > 2E_g$  ( $E_{pm} = 24$  eV).

## Ветвление релаксации электронных возбуждений в ВеО (обсуждение результатов)

Время-разрешенные СЛ кристаллов ВеО при селективном фотовозбуждении характеризуются несколькими типами свечений: быстрые свечения с максимумами полос при 4.0 и 5.0 eV и медленные с максимумами полос при 4.2–4.7 и 6.7 eV. Принципиально важным является установление природы наблюдаемых свечений: обусловлены ли они излучательной релаксацией ЭВ в регулярной решетке (собственное свечение) или связаны с дефектами структуры кристалла. При выяснении этого вопроса наиболее информативными представляются время-разрешенные СВЛ.

Так, из спектра возбуждения быстрой люминесценции  $5.0 \,\mathrm{eV}$  (кривые 2 на рис. 2, а и 5, а) следует, что это свечение наиболее эффективно возбуждается в области 10.2-10.3 eV, лежащей ниже энергии первого пика экситонного отражения на 120-200 meV (ср. с кривыми 2 на рис.2, b и 5, b). Этот факт свидетельствует о том, что излучательная релаксация ЭВ происходит около дефекта кристаллической структуры. В случае быстрого свечения 4.0 eV ситуация иная. Хотя СВЛ этой полосы в "быстром" временном окне также содержит максимум в области 10.2-10.3 eV (кривые 1 на рис. 2, а и 5, а), этот максимум формируется вкладом медленных составляющих, безусловно доминирующих в этой области в СВЛ, измеренных в "медленном" временном окне (кривые 1 на рис. 2, b и 5, b). Тот факт, что быстрое свечение 4.0 eV действительно не возбуждается в области 10.2-10.3 eV, подтверждается и отсутствием короткого компонента в кинетике люминесценции в случае возбуждения в полосе 10.24 eV (ср. кривые 1 и 2 на рис. 3, d). Это позволяет заключить, что быстрое свечение 4.0 eV возбуждается исключительно в области состояний экситона Е<sub>n=2</sub>, Е<sub>n=3</sub> и в области междузонных переходов, т. е. имеет собственный характер.

Медленные свечения в ВеО также обнаруживают различную природу. Люминесценция в области 4.2 eV эффективно возбуждается в области 10.2-10.3 eV (кривая 2 на рис. 2, *a*) и, таким образом, соответствует излучательной аннигиляции ЭВ около дефекта. Напротив, свечение с максимумом в области 4.4-4.7 eV (в зависимости от ориентации) обнаруживает собственный характер, поскольку возбуждается в области, непосредственно примыкающей к пикам экситонного отражения, а также в области междузонных переходов ( $E_{\text{exc}} > E_g$ ) (кривая 2 на рис. 2, *b*).

Полоса ВУФ-свечения 6.7 eV не перекрывается с другими полосами люминесценции и характеризуется единственным компонентом кинетики затухания. Вид СВЛ этого свечения (рис. 6) свидетельствует об его собственном характере. Это подтверждает ранее сделанное предположение о том, что ВУФ-люминесценция связана с излучательным распадом АЛЭ (см., например, [9]).

Таким образом, в ориентированных кристаллах ВеО при T = 10 К методом селективной время-разрешенной ВУФ-спектроскопии можно выделить следующие свечения собственного характера: быстрое — 4.0 eV ( $\tau = 2.2$  ns) и более медленные — 4.4–4.7 eV ( $\tau_1 = 54$  ns и  $\tau_2 = 36 \,\mu$ s) и 6.7 eV ( $\tau = 340 \,\mu$ s). Остальные полосы люминесценции, формирующие СЛ, следует считать связанными с излучательным распадом ЭВ около дефектов кристаллической структуры. Анализ зависимости СВЛ показывает, что эффективность возбуждения

собственных свечений в областях энергий основного  $(E_{n=1})$  и возбужденных  $(E_{n=2}, E_{n=3})$  состояний экситонов зависит от ориентации кристалла. Например, СВЛ АЛЭ 6.7 eV (кривые 1 и 2 на рис. 6) свидетельствует о существовании ориентационной зависимости релаксации экситонов из основного и возбужденных состояний в автолокализованное состояние. Ранее для низкосимметричных оксидных кристаллов ( $\alpha$ -Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, YAlO<sub>3</sub>, Y<sub>3</sub>Al<sub>5</sub>O<sub>12</sub>) установлено, что релаксация экситона в автолокализованное состояние и рекомбинационная сборка экситона малого радиуса приводят к формированию разных центров свечения [10]. В настоящей работе впервые для широкощелевых кристаллов удалось наблюдать ориентационно обусловленное ветвление релаксации экситонов с образованием разных излучательных центров.

Экспериментальные данные показывают, что быстрое собственное свечение 4.0 eV в BeO по своим спектрально-кинетическим, ориентационным, поляризационным характеристикам существенно отличается от ранее изученных свеченеий АЛЭ в BeO (см., например, [7,9]). Электронная структура BeO [18] не дает предпосылок для связи его с валентно-остовными переходами, формирующими характерное быстрое свечение в ряде кристаллов. Вид СВЛ 4.0 eV подтверждает предположение работ [13,14] о его связи с люминесценцией синглетных АЛЭ. Преимущественная релаксация экситонов на синглетный излучательный уровень АЛЭ в BeO идет с возбужденных состояний экситона  $E_{n=2}$ ,  $E_{n=3}$ , что ранее наблюдалось также и для щелочных иодидов [2,3].

Известно, что в ЩГК свечение триплетных АЛЭ поляризовано перпендикулярно, а свечение синглетных АЛЭ — параллельно оси двухгалоидного дырочного ядра АЛЭ [1,4]. Триплетный характер состояния, переходы с которого формируют ВУФ-полосу в СЛ ВеО, в настоящее время не вызывает сомнения, а модель центра свечения 6.7 eV предложена нами ранее [9] как АЛЭ с дырочным ядром в вдие полярона малого радиуса типа О-иона в аксиальной конфигурации локального тетраэдра кристаллической структуры. Принципиальным вопросом интерпретации быстрого свечения 4.0 eV в ВеО является его более низкоэнергетическое по сравнению со свечениями триплетных АЛЭ спектральное положение. Подобная ситуация реализуется, в частности, в кристаллах NaI, NaBr [2]: полоса синглетного АЛЭ проявляется в СЛ с длинноволновой стороны от триплетного (сдвиг составляет несколько десятков meV). В модели адиабатических кривых потенциальной энергии объяснение этого факта состоит в том, что минимум потенциальной энергии синглетного АЛЭ имеет конфигурационную координату Q2, значительно бо́льшую, чем координата триплетного состояния Q<sub>1</sub> [2]. Для ВеО наблюдаемая разница энергий триплетного и синглетного состояний существенно больше. Однако следует учитывать, что кристаллическая структура оксида бериллия характеризуется более низкой симметрией ( $C_{3\nu}$ ). Возникающее при автолокализации экситонов локальное искажение решетки еще более понижает локальную симметрию кристалла. Это может являться причиной более существенного, чем в ЩГК, относительного смещения координат триплетного и синглетного состояний.

В [2,3] для ЩГК установлено, что в случае излучательного распада АЛЭ, отличающихся степенью смещения двухгалоидного дырочного ядра от регулярного положения ионов к интерстициальному, возникают различные полосы люминесценции. Полоса свечения АЛЭ, соответствующая наибольшему смещению, характеризуется также и наибольшим стоксовым сдвигом. В оксиде бериллия стоксов сдвиг максимален для свечения 4.0 eV. Можно предположить, что соответствующий короткоживущий центр свечения возникает при самой значительной локальной деформации кристалла. Если по аналогии с ЩГК предположить, что в ВеО также имеет место тенденция смещения аниона к интерстициальному положению, то возникающий центр свечения можно представить себе как короткоживущий дефект типа  $F^+$ -центра. Тот факт, что кристаллическая структура широкозонных оксидов в момент релаксации ЭВ действительно испытывает существенную деформацию, доказан в [19] непосредственным измерением кратковременного изменения объема кристалла  $\alpha$ -Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> (в  $\alpha$ -Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> осуществляется сходная с ВеО ситуация самозахвата экситонов [20]) после возбуждения импульсом электронов. Величина наблюдаемого в [19] увеличения объема кристалла оказалась сравнимой с характерной для ЩГК. На это также указывает наблюдение люминесценции *F*- и *F*<sup>+</sup>-центров в номинально чистых кристаллах  $\alpha$ -Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> [21] и кристаллах BeO при импульсном возбуждении электронами подпороговых энергий, не создающих стабильные френкелевские дефекты. Отметим, что стабильный F<sup>+</sup>-центр в оксиде бериллия характеризуется полосой люминесценции с максимумом при  $3.92 \,\text{eV}$  (FWHM =  $0.5 \,\text{eV}$ ) и временем затухания менее 1 ns [22,23]. Люминесценция 4.0 eV возникает при релаксации экситонов из возбужденных состояний. В ряде ЩГК (NaCl, KI) преимущественная релаксация экситонов именно с возбужденных состояний n = 2 приводит к ситуации подпорогового дефектообразования [24]. Таким образом, по спектральнополяризационным характеристикам (данные [13,14] и результаты настоящей работы) быстрое свечение 4.0 eV следует отнести к "аксиальному" синглетному АЛЭ.

При создании электронно-дырочных пар фотонами с  $E_{\rm exc} > 11 \, {\rm eV}$  с ростом энергии возбуждения CBЛ 4.7 и 6.7 eV резко отличаются. В соответствии с теорией "горячего разлета электронно-дырочных пар" [25] это указывает на различные миграционные потери: образование АЛЭ со свечением 6.7 eV происходит без миграционных потерь, место автолокализации практически совпадает с местом рождения ЭВ. Это подтверждается большим значением константы экситон-фононного взаимодействия  $\sigma_0 = 0.6$ , определенным из анализа правила Урбаха в ВеО [5]. Образование же АЛЭ со свечением 4.7 eV происходит после миграции ЭВ. Авторы признательны В.А. Маслову за предоставление образцов и долговременное сотрудничество, а также Г.Н. Кулипанову и Э.И. Зинину за содействие и помощь в постановке работ в Сибирском центре синхротронного излучения, стимулировавших настоящее исследование.

#### Список литературы

- [1] Ч.Б. Лущик. Экситоны. Наука, М. (1985). С. 362-385.
- [2] T. Matsumoto, T. Kawata, A. Miyamoto, K. Kan'no. J. Phys. Soc. Jap. 61, 11, 4229 (1992).
- [3] T. Matsumoto, M. Shirai, K. Kan'no. J. Phys. Soc. Jap. 64, 3, 987 (1995).
- [4] K.S. Song, R.T. Williams. Self-trapped excitons. Springer-Verlag, Berlin–Heidelberg (1993).
- [5] D.M. Roessler, W.C. Walker, E. Loh. J. Phys. Chem. Sol. 30, 1, 157 (1969).
- [6] J.L. Freeouf. Phys. Rev. **B7**, 3810 (1973).
- [7] V.Yu. Ivanov, V.A. Pustovarov, A.V. Kruzhalov, B.V. Shulgin. Nucl. Instr. Meth. Phys. Res. A282, 559 (1989).
- [8] E. Feldbach, W. Laasch, D. Varding, G. Zimmerer. Phys. Stat. Sol. (b) **170**, 623 (1992).
- [9] В.Ю. Иванов, В.А. Пустоваров, С.В. Горбунов, А.В. Кружалов. ФТТ 36, 9, 2634 (1994).
- [10] А.И. Кузнецов, В.Н. Абрамов, В.В. Мюрк, Б.Р. Намозов. ФТТ 33, 7, 2000 (1991).
- [11] V. Mürk, B. Namozov, N. Yaroshevich. Radiation Measurements 24, 4, 371 (1995).
- [12] Б.Р. Намозов, М.Э. Фоминич, В.В. Мюрк, Р.И. Захарченя. ФТТ 40, 5, 910 (1998).
- [13] В.А. Пустоваров, В.Ю. Иванов, А.В. Кружалов, Э.И. Зинин. ФТТ 36, 5, 1523 (1994).
- [14] В.А. Пустоваров, В.Ю. Иванов, А.В. Кружалов, Э.И. Зинин. ЖПС **60**, *5*–*6*, 443 (1994).
- [15] В.Ю. Иванов, В.А. Пустоваров, С.В. Горбунов, С.В. Кудяков, А.В. Кружалов. ФТТ **38**, *11*, 3333 (1996).
- [16] В.А. Маслов, Г.М. Рылов, В.Г. Мазуренко, А.В. Кружалов. Расширенные тезисы VI Междунар. конф. по росту кристаллов. М. (1980). Т. 3. 268 с.
- [17] G. Zimmerer. Nucl. Instr. Meth. Phys. Res. A308, 178 (1991).
- [18] В.А. Лобач, И.Р. Рубин, А.В. Кружалов. ФТТ 29, 9, 2610 (1987).
- [19] C. Itoh, K. Tanimura, N. Itoh. J. Phys. C: Solid State Phys. 19, 35, 6887 (1986).
- [20] M. Kirm, G. Zimmerer, E. Feldbach, A. Lushchik, Ch. Lushchik, F. Savikhin. Phys. Rev. B60, 1, 502 (1999).
- [21] В.И. Барышников, Е.Ф. Мартынович, Т.А. Колясникова, Л.И. Щепина. ФТТ 30, 5, 214 (1988).
- [22] S.V. Gorbunov, A.V. Kruzhalov, M.J. Springis. Phys. Stat. Sol. (b) 141, 293 (1987).
- [23] V.A. Pustovarov, M. Kirm, A.V. Kruzhalov, V.S. Kortov, A.I. Surdo, G. Zimmerer. Annual Report, DESY, HASYLAB. Hamburg (1999). P. 331.
- [24] Ч.Б. Лущик, А.Ч. Лущик. Распад электронных возбуждений в твердых телах. Наука, М. (1989). 262 с.
- [25] А.Н. Васильев, В.В. Михайлин, И.В. Овчинникова. Изв. АН СССР. Сер. физ. 49, 2044 (1985).